

SCREEN

# Semiconductor Solutions

半導体製造装置総合カタログ



## Cutting-Edge Devices



**SU-3400**  
Single Wafer Cleaner



**SU-3300**  
Single Wafer Cleaner



**SU-3200**  
Single Wafer Cleaner



**SS-3300S**  
Spin Scrubber



**SS-3200**  
Spin Scrubber



**SB-3300**  
Backside Cleaner



**FC-3100**  
Wet Station



**DT-3000**  
Coat/Develop Track



**LA-3100**  
Flash Lamp  
Annealer



**RF-300EX**  
Coat/Develop Track



**RF-200EX**  
Coat/Develop Track



**ZI-2000**  
Pattern Inspection  
System



**VM-2500/  
VM-3500**  
Film Thickness  
Measurement System



**SU-2000**  
Single Wafer Cleaner



**SP-2100**  
Spin Processor



**SS-80EX**  
Spin Scrubber



**WS-620C/  
WS-820C/820L**  
Wet Station



**FC-821L**  
Wet Station



**CW-2000**  
Compact Wet Station



**SK-60EX/80EX**  
Coat/Develop Track



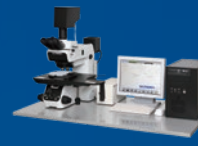
**SC-80EX**  
Spray Coater



**ZI-3600**  
Pattern Inspection  
System



**VM-1200/  
VM-1300**  
Film Thickness  
Measurement System



**VM-1020**  
Film Thickness  
Measurement System



**RE-3500**  
Film Thickness  
Measurement System

## IoT Applications

SCREEN's Product Lineup Covers Various  
Semiconductor Manufacturing Processes

Process Technology Center  
Global Training Center

Corporate Philosophy  
Company Profile

Efforts to Realize  
a Sustainable Society

# Introducing coat/develop track systems for next-generation power devices and automotive devices

次世代パワーデバイス・車載デバイス向けコート・デベロッパ登場



RF-200EX



RF-300EX

Contributing to the device industry through high productivity,  
a small footprint, improved ease of maintenance  
and operability plus eco-friendly processing to support GX.

GXを実現するグリーン対応をはじめ、  
メンテナンス性や操作性を向上させ、高い生産力と省フットプリントでデバイス業界に貢献します。

# *LithoSpin* **NEW**

## Coat/Develop Track

コータ・デベロッパ

# RF-200EX

Wafer  
size **150-200** mm

### FEATURES

- ▶ **Expandability and flexibility to handle both legacy processes and DUV processes**  
レガシープロセスにもDUVプロセスにもフレキシブルに対応可能な拡張性
- ▶ **300 mm unit technology is redeployed in a new 150–200 mm dedicated platform system**  
300mm対応装置のユニット技術を、150～200mm専用の  
新プラットフォーム装置に移植

## Coat/Develop Track

コータ・デベロッパ

# RF-300EX

Wafer  
size **300** mm

### FEATURES

- ▶ **For thin wafers**  
薄ウェーハ対応
- ▶ **Handles a broad range of chemical solutions for resist, polyimide, SOC and other applications**  
多種・多様な薬液に対応：レジスト、ポリイミド、SOCなど





## Single Wafer Cleaner

枚葉式洗浄装置

# SU-3400

Wafer  
size **300** mm

### The evolution of the world's No. 1<sup>\*1</sup> cleaning equipment

さらなる進化をとげる、  
世界シェアNo.1<sup>\*1</sup>洗浄装置

#### FEATURES

- ▶ **High productivity with a maximum throughput of 1,200 wph**  
最大毎時1,200枚のハイスループットで高い生産性を実現
- ▶ **Footprint reduced by 30%<sup>\*2</sup>**  
フットプリント30%削減<sup>\*2</sup>
- ▶ **Reduction of environmental load:  
Exhaust/Nitrogen/Chemical**  
環境負荷(排気/窒素/薬液)を低減
- ▶ **Reliable operation backed by big data and  
problem prevention through camera surveillance**  
ビッグデータを活用した安定稼働と  
カメラ監視によるトラブル防止を実現

<sup>\*1</sup> Based on SCREEN in-house research  
※1 当社調べ

<sup>\*2</sup> Compared to SU-3300  
※2 「SU-3300」との比較





## Single Wafer Cleaner

枚葉式洗浄装置

SU-3300

AQUASPIN

Wafer size 300 mm

A single-wafer cleaner with up to 24 chambers,  
offering first-tier processing technology and outstanding productivity

最大24チャンバによる高い生産性と、  
最高水準の処理技術を結集した枚葉式洗浄装置

## FEATURES

- ▶ Improved processing environment through technology for increasing chamber cleanliness  
チャンバ内の清浄度を高める新技術により、処理環境向上
- ▶ Cutting-edge drying technology for rapid, high-precision control of the wafer surface air-liquid interface  
最新の乾燥技術により、ウェーハ上の気液界面を高精度かつスピーディに制御
- ▶ Optimal discharge of chemical solution for outstanding etching uniformity  
最適な薬液を吐出し、優れたエッチング均一性を実現



## Single Wafer Cleaner

枚葉式洗浄装置

SU-3200

AQUASPIN

Wafer size 300 mm

The de facto standard in single wafer cleaners,  
expandable up to 12 chambers

12チャンバを搭載した、  
デファクトスタンダードの枚葉式洗浄装置

## FEATURES

- ▶ Handles a wide range of chemical solutions for enhanced processing flexibility  
豊富な対応薬液により、幅広いプロセスで活躍
- ▶ Versatile chemical supply system  
多彩な薬液供給システムを搭載
- ▶ Designed for exceptionally easy maintenance  
優れたメンテナンス性を誇る装置設計



Spin Scrubber  
スピンスクラバ

# SS-3300S

AQUASPIN

Wafer size **300 mm**

**Next-generation spin scrubber with 16 processing chambers  
for high throughput of up to 1,000 wph**

16チャンバ搭載、最大毎時1,000枚のハイスループットを実現した  
次世代スピンスクラバ

#### FEATURES

- ▶ **Dual transport system for greater productivity**  
デュアル搬送システムにより、生産性が向上
- ▶ **27% smaller footprint than two 8-chamber SS-3200 spin scrubbers**  
8チャンバの「SS-3200」2台と比べ、フットプリントを27%削減
- ▶ **Handles a wide range of processes. Proprietary spray technology and brush function also available as options**  
幅広いプロセスに対応。独自のスプレー技術、ブラシ機能をオプションで搭載可能



Spin Scrubber  
スピンスクラバ

# SS-3200

AQUASPIN

Wafer size **300 mm**

**High throughput has made it  
the de facto standard in spin scrubbers**

高生産性を誇る  
デファクトスタンダードのスピンスクラバ

#### FEATURES

- ▶ **An advanced transport system and proprietary algorithm deliver approximately twice the throughput\* of the previous model**  
最先端搬送機構と独自のアルゴリズムにより、  
従来装置比約2倍\*のハイスループットを実現
- ▶ **Offers the same chamber configuration, cleaning items, and other processing functions as the SS-3100**  
チャンバ構造や洗浄アイテムなど、SS-3100のプロセス性能を継承

\* Compared to SS-3100  
※「SS-3100」との比較



AQUASPIN

## Backside Cleaner

ウェーハ裏面洗浄装置

SB-3300

Wafer  
size 300 mmHybrid-chemical and  
brush cleaning functions「ブラシ洗浄」と「薬液洗浄」を併せ持つ、  
ハイブリッド洗浄装置

## FEATURES

- ▶ The industry's first\* hybrid-type chemical and brush cleaning system for more effective removal of particles from the backside of wafers

業界初\*の薬液とブラシのハイブリッド洗浄による、  
ウェーハ裏面の高いパーティクル除去性能

- ▶ High precision etching control for the backside of wafers minimizes wafer warping

高精度な裏面コントロールエッチングによる、ウェーハの反りの抑制

- ▶ A proprietary chuck system securely holds the device side of wafers

独自のチャックシステム採用による、デバイス面の確実な保護

\* Based on SCREEN in-house research (as of December 2020)

※2020年12月時点での当社調べ



## Wet Station

ウェットステーション

# FC-3100

Wafer  
size **300** mm

**The de facto standard batch-type cleaner  
that boasts high productivity,  
stability and reliability**

高い安定性と信頼性を兼ね備えた、  
高生産性を誇るデファクトスタンダードのバッチ式洗浄装置

### FEATURES

- ▶ **7 independent modules enhance system configuration flexibility**  
7つの独立モジュールの組み合わせによる、フレキシブルなシステム構成
- ▶ **High throughput of up to 1,000 wph**  
最大毎時1,000枚のハイスループット
- ▶ **The HiLPD (low-pressure drying) greatly reduces watermarks and high-concentration IPA vapor prevents pattern collapse**  
減圧乾燥システム「HiLPD」を搭載し、ウォータマークを大幅に抑制  
高濃度IPAにより、パターン倒壊を防止





## Coat/Develop Track

コート・デベロッパ

# DT-3000

Wafer size **200-300 mm**

**Coat/develop track equipped  
with a dual track system  
for a high throughput of over 450 wph**

毎時450枚超のハイスループットを誇る、  
デュアルトラックシステム搭載のコート・デベロッパ

### FEATURES

- ▶ **High productivity and a compact footprint**  
高生産性と省フットプリントを実現
- ▶ **Dual-track system enables non-stop operation**  
デュアルトラックシステムにより、  
ノンストップオペレーションが可能
- ▶ **Supports EUV and immersion multi-patterning**  
EUV、液浸マルチパターニングにも対応



## Flash Lamp Annealer

フラッシュランプアニール装置

# LA-3100

Wafer  
size **300** mm

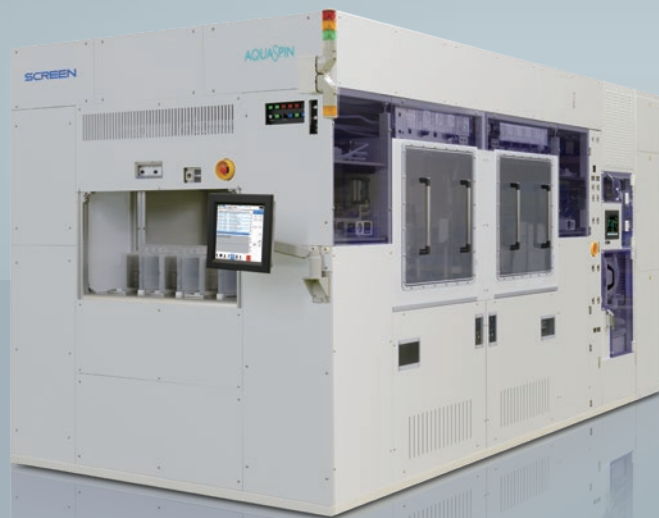
**The flash lamp annealer significantly contributing  
to the characteristic advancement of  
cutting-edge devices**

最先端デバイスの特性改善に大きく貢献する、  
フラッシュランプアニール装置

### FEATURES

- ▶ **Fast annealing over a wide temperature range**  
短時間で幅広い温度範囲のアニールが可能
- ▶ **Flash annealing and assist heating enable millisecond annealing**  
フラッシュアニールとアシスト加熱により、ミリ秒単位のアニールが可能
- ▶ **Flexible temperature profile control in sub-millisecond units**  
サブミリ秒単位での柔軟な温度プロファイル制御が可能





## Single Wafer Cleaner

枚葉式洗浄装置

AQUASPIN

SU-2000

Wafer size 150-200 mm

Single wafer cleaner delivering exceptional cost performance  
with proven high-end cleaning technology

ハイエンドの洗浄技術を継承し、高コストパフォーマンスを実現した枚葉式洗浄装置

## FEATURES

- ▶ **Flexible chamber configuration enables advanced processing**  
フレキシブルなチャンバ構成で、高度なプロセス処理に対応
- ▶ **Chuckling mechanism handles substrates from standard size to thin wafers**  
通常ウェーハから薄ウェーハまで対応可能なチャッキング機構
- ▶ **MV scanning technology enhances wafer etching uniformity**  
ウェーハエッチングの均一性を高めるMVスキャン技術を搭載



## Spin Processor

スピンプロセッサ

AQUASPIN

SP-2100

Wafer size 76-200 mm

A spin processor that meets needs  
with a variety of functions and expandability

多彩な機能と拡張性で、時代のニーズに対応したスピンプロセッサ

## FEATURES

- ▶ **Suitable for a wide range of compound wafers including SiC, GaN, and LiTaO<sub>3</sub>**  
SiC、GaN、LiTaO<sub>3</sub>などの多様な化合物ウェーハに対応
- ▶ **Flexibly handles wafer sizes from 76 to 200 mm**  
76～200mmのウェーハサイズにフレキシブルに対応
- ▶ **Handles a wide range of processes including RCA cleaning, metal etching, and aluminum etching**  
RCA洗浄、メタルエッチング、アルミエッチング工程など、幅広いプロセスに対応





Spin Scrubber  
スピンスクラバ

# SS-80EX

AQUASPIN

Wafer size 100-200 mm

## Spin scrubber combining high productivity and functionality

高生産性と多機能性を兼ね備えたスピンスクラバ

### FEATURES

- ▶ **Equipped with 5 varieties of cleaning tools to meet a wide range of needs**  
多彩な5種類の洗浄ツールを搭載し、幅広いニーズに対応
- ▶ **Precision bevel cleaning contributes to yield increase**  
精密なベベル洗浄で歩留まり向上に貢献
- ▶ **Maintenance can be performed during operation, reducing downtime**  
稼働中のメンテナンスが可能になり、ダウンタイムを低減



Wet Station  
ウェットステーション

# WS-620C/ WS-820C/820L

Wafer size 150-200 mm

## High-throughput batch cleaning systems enabling flexible line configuration

フレキシブルなライン構成が可能な、ハイスループットのバッチ式洗浄装置

### FEATURES

- ▶ **Flexible system configuration for a wide range of processes**  
柔軟なシステム構成により、幅広いプロセスに対応
- ▶ **Can be equipped with multiple baths and up to 6 transfer robots for higher productivity**  
複数の処理槽と最大6台の搬送ロボットにより、高い生産性を発揮
- ▶ **Two types of transfer enable handling even of special wafers**  
2種類の搬送システムにより、特殊なウェーハにも対応可能
- ▶ **Newly developed S-LPD technology reduces drying time by 50%\* compared to the conventional method**  
新規開発のS-LPD技術により、乾燥時間を従来比50%※短縮

\* Compared to the conventional LPD technology  
※従来のLPD技術との比較



## Wet Station

ウェットステーション

# FC-821L

Wafer size **200 mm**

### Compact half-pitch and one-bath batch cleaning system

ハーフピッチとワンバスを採用した、省スペースバッチ式洗浄装置

#### FEATURES

- ▶ **Enables half-pitch transfer of wafers. The size of baths has been reduced to minimize the volume of chemicals and DI water used**  
ウェーハのハーフピッチ搬送を実現。処理槽を小型化することで、薬液、純水の使用量を削減
- ▶ **The CHB chemical circulation bath allows for the use of high-temperature and high-concentration chemicals**  
薬液循環槽(CHB)を搭載することにより、高温薬液や高濃度薬液も使用可能
- ▶ **A low-pressure dryer prevents watermarks and pattern collapse**  
減圧乾燥により、ウォーターマークとパターン倒壊を抑制



## Compact Wet Station

コンパクトウェットステーション

# CW-2000

Wafer size **50-200 mm**

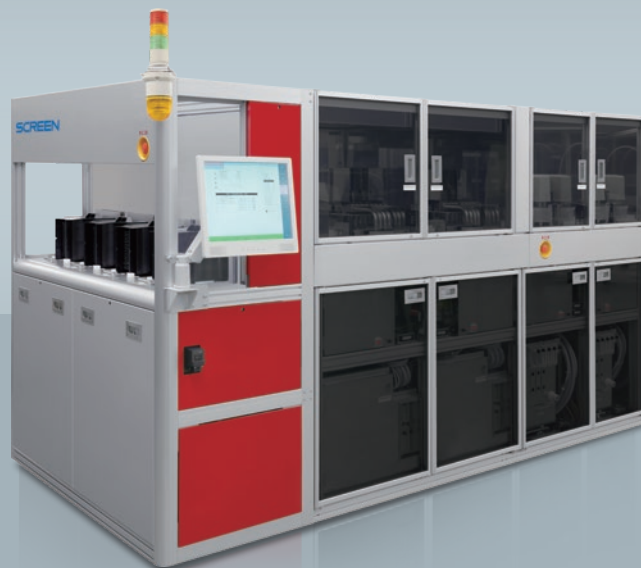
### An efficient batch-type cleaner with half the footprint\* and 1.5 times the productivity\*

フットプリント1/2※、生産性1.5倍※の、ハイクストパフォーマンスなバッチ式洗浄装置

#### FEATURES

- ▶ **Space saving achieved through an all-in-one concept**  
オールインワンコンセプトによる省スペース化を実現
- ▶ **In addition to a DIS (Drain & IPA Substitution) drying system, an eco-friendly hot air blow-drying system using no IPA is also available**  
DIS(Drain & IPA Substitution)乾燥に加え、IPAを使用しない温風乾燥が選択可能
- ▶ **The number of processing tanks can be increased (4, 6, 8 tanks)**  
処理槽数を拡張可能(4・6・8槽)

\* Compared to CW-1500  
※「CW-1500」との比較



## Coat/Develop Track

コータ・デベロッパ

**SK-60EX/SK-80EX** Wafer size **150-200 mm**

**Coat/develop tracks featuring a variety of applications and functions to meet diverse device needs**

多様化するデバイスニーズに応える、  
充実の対応アプリケーションと機能を搭載したコータ・デベロッパ

### FEATURES

- ▶ **Capable of handling a wide range of substrates, including thin wafers and thick substrates**  
薄ウェーハや厚基板など、多種・多様な基板に対応
- ▶ **Handles multiple chemical solutions for resist and polyimide coatings, etc.**  
レジスト、ポリイミドなどの複数薬液に対応
- ▶ **Various options are available for handling an increasingly diverse range of electronic devices**  
多様化する電子デバイスにさまざまなオプションで対応



## Spray Coater

スプレーコータ

**SC-80EX** Wafer size **100-200 mm**

**Spray coater capable of flexible, optimized coating of uneven 3D structures**

凹凸のある立体構造への  
最適かつフレキシブルな塗布を実現したスプレーコータ

### FEATURES

- ▶ **Stable, uniform coating on uneven stepped and through-hole substrates**  
凹凸のある段差基板や貫通基板への、安定的かつ均一な塗布を実現
- ▶ **Capable of spraying thick film coatings using minimal chemicals**  
少ない薬液消費量での厚膜塗布が可能
- ▶ **Simple system configuration enables easy maintenance, greatly reducing downtime**  
シンプルな装置構造でメンテナンスが容易。ダウンタイムを大幅に低減



## Wafer Pattern Inspection System

パターン付きウェーハ外観検査装置

# ZI-3600

Wafer size **100-300 mm**

**Equipped with three lenses in different resolutions**

**A wafer pattern inspection system with high resolution and productivity**

分解能の異なる3種類のレンズを搭載

高分解能と高生産性を両立したパターン付きウェーハ外観検査装置

### FEATURES

- ▶ **Doubling\* the throughput of the previous model**  
従来比約2倍\*のスループットを実現
- ▶ **Able to detect and analyze of micro-defects smaller than 1 μm**  
1 μm以下の微細欠陥の検出や不良解析が可能
- ▶ **Easy to create recipes using actual wafer images**  
実際のウェーハ画像を確認しながら容易にレシピ作成が可能

\* Compared to ZI-3500

※「ZI-3500」との比較



## Wafer Pattern Inspection System

パターン付きウェーハ外観検査装置

# ZI-2000

Wafer size **76-200 mm**

**Compact high-speed wafer pattern inspection system offering exceptional efficiency**

ハイスピード、コンパクト、

コストパフォーマンスを追求した外観検査装置

### FEATURES

- ▶ **High-speed inspection is unaffected by the size or number of chips on a wafer**  
ウェーハ内のチップサイズや個数に影響されないハイスピード検査
- ▶ **Uses a comparative inspection method that does not require pre-training with a reference image**  
事前学習画像を必要としない比較検査方式を採用
- ▶ **Numerous useful functions, including real-time auto defect classification**  
リアルタイム自動欠陥分類など、多様な機能を搭載





## Spectroscopic Film Thickness Measurement System

光干渉式膜厚測定装置

VM-2500/VM-3500

Wafer  
size 100-300 mm

## Mass production capacity throughput with multi-point measurement capability

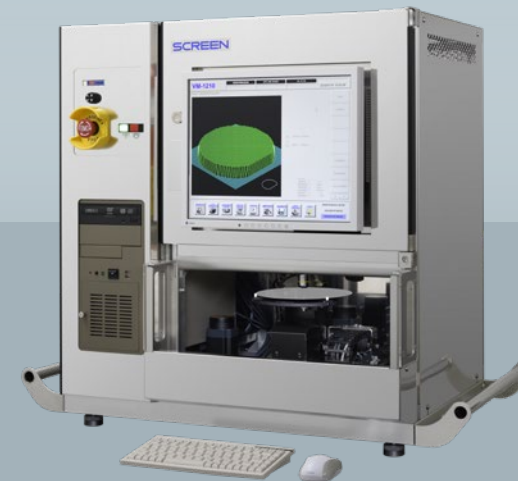
量産に適した高スループット・多点測定可能な膜厚測定装置

## FEATURES

- ▶ **A mass production level throughput of 160 wph in high-speed mode (SiO<sub>2</sub>, 5-point measurement)\***  
高速モードで毎時160枚のハイスループットを実現(SiO<sub>2</sub>、5ポイント測定時)\*
- ▶ **Easy recipe creation**  
容易なレシピ作成
- ▶ **Equipped with log function for improved maintenance support**  
ログ保存機能を装備しているため、メンテナンスサポートが向上

\* VM-3500: 100 wph

※ VM-3500は毎時100枚



## Spectroscopic Film Thickness Measurement System

光干渉式膜厚測定装置

VM-1200/VM-1300

Wafer  
size 100-300 mm

## Desktop-type spectroscopic film thickness measurement systems for production lines

生産ラインへの導入も可能な卓上タイプの膜厚測定装置

## FEATURES

- ▶ **Simultaneous measurement of the entire wavelength range of visible light for rapid, high-precision measurement of film thickness**  
可視光の全波長域同時測定により、膜厚を高速・高精度に測定
- ▶ **Simultaneous measurement of up to 4 film layers**  
最大4層膜まで同時測定が可能



## Spectroscopic Film Thickness Measurement System

光干渉式膜厚測定装置

# VM-1020

Wafer size **50-300 mm**

**Microscope-type spectroscopic film thickness measurement system ideal for R&D**

R&Dに最適な顕微鏡タイプの膜厚測定装置

### FEATURES

- ▶ **Compact model consisting of a microscope and a spectrometer**  
顕微鏡部と分光器で構成したコンパクトモデル
- ▶ **In addition to the wide range of preset measurement programs, a user registration function enables creation of custom programs**  
幅広い測定プログラムに加え、ユーザー登録機能により、自由なプログラム作成が可能



## Ellipsometric Film Thickness Measurement System

エリプソ式膜厚測定装置

# RE-3500

Wafer size **125-300 mm**

**High-end ellipsometric film thickness measurement system**

分光エリプソメータを搭載したハイエンド膜厚測定装置

### FEATURES

- ▶ **Precise measurement of minute areas down to 40  $\mu\text{m}$  square**  
40  $\mu\text{m}$ 角の微細なエリアを高精度に測定
- ▶ **Equipped with a spectroscopic ellipsometer for simultaneous measurement of film thickness and optical constants**  
分光エリプソメータ搭載により、膜厚と光学定数の同時測定が可能
- ▶ **Can be equipped with an optional single wavelength ellipsometer for high-precision measurement of ultra-thin films**  
超薄膜を高精度で測定可能な単波長エリプソメータも搭載可能(オプション)

# SCREEN's Product Lineup Covers Various Semiconductor Manufacturing Processes

半導体製造プロセスを支えるSCREENのラインアップ

## Front-end Wafer Process 前工程

Cleaning  
洗浄

The silicon wafers that form the base of the semiconductor are cleaned. Even a slight contamination of a wafer will cause defects in the circuit. Therefore, chemical agents are used to remove all contamination, from ultra-fine particles to minute amounts of organic (oil, etc.) or metallic residues generated in the production process, or unwanted native oxide layers generated due to exposure to air.

薬液を使って超微細なパーティクル（ゴミ）をはじめ、製造工程で発生した微量の有機汚染（油脂など）や金属汚染、大気に触れることで生成される自然酸化膜などを除去します。

▶ FC-3100/WS-820L/CW-2000 Wet Station

▶ SU-3400/SU-3200/SU-2000 Single Wafer Cleaner

FC-3100

▶

Film Deposition  
成膜

A thin film that will become the circuit material is formed on the wafer. There are a number of ways to form these films, including chemical vapor deposition (CVD), sputtering, and thermal oxidation.

ウェーハ上に回路の素材となる薄膜を形成します。成膜の方法には、「CVD法」「スパッタ法」「熱酸化」などがあります。成膜では形成された薄膜を正確に検査、管理する必要があります。

▶ RE-3500  
Ellipsometric Film Thickness Measurement System

▶ VM-3500/VM-2500  
Spectroscopic Film Thickness Measurement System

RE-3500

▶

Post-Deposition Cleaning  
成膜後洗浄

Minute particles adhering to the wafer after film deposition are removed using brushes, spray, or other physical cleaning methods.

成膜後に付着した微細なパーティクルを純水や薬液を用いてブラシやスプレー（水の粒子）などの物理洗浄で除去します。

▶ SS-3300S/SS-3200  
Spin Scrubber

▶ SB-3300  
Backside Cleaner

▶ SU-3400/SU-3200/SU-2000  
Single Wafer Cleaner

SS-3300S SB-3300

▶

Resist Coating  
レジスト塗布

The wafer surface is coated with resist (photosensitive polymer). The wafer is then spun, causing a uniform layer of resist to be formed on its surface by centrifugal force.

レジスト（感光液）をウェーハ表面に塗布します。ウェーハを回転させ、遠心力で均一なレジスト膜を形成します。

▶ DT-3000/RF-300EX

▶ RF-200EX/SK-80EX/SK-60EX  
Coat/Develop Track

RF-200EX RF-300EX

▶

Exposure  
露光

The wafer is exposed using short-wavelength, deep-ultraviolet radiation projected through a mask on which the circuit pattern has been formed. Only the areas of the resist layer that are exposed to the light undergo a structural change, thereby transferring the pattern to the wafer. There are a variety of exposure units, including steppers, which expose several chips at a time, and scanners, which expose the wafer using a slit through which light is projected onto the wafer.

半導体の回路パターンが描画されたマスクを介して、紫外線をウェーハ表面に照射し、光が照射されたレジスト膜の部分にパターンを転写します。露光装置はレンズにより、マスクのパターンをウェーハに縮小投影し、矩形領域を1回露光後、ウェーハのみを移動させ、再び矩形領域を露光することを繰り返します。

▶ DT-3000/RF-300EX

▶ RF-200EX/SK-80EX/SK-60EX  
Coat/Develop Track

RF-200EX RF-300EX

▶

Development  
現像

The resist pattern is etched on the wafer surface by discharging a developer (chemical solution) onto the surface of the exposed resist film which removes the redundant areas.

露光されたレジスト膜表面に現像液（薬液）を吐出します。不要な部分のレジスト膜を除去し、ウェーハ上にレジストパターンを形成します。

▶ DT-3000/RF-300EX

▶ RF-200EX/SK-80EX/SK-60EX  
Coat/Develop Track

RF-200EX RF-300EX

## Packaging Process 後工程

Inspection/Assembly  
検査・組み立て

After the wafer processes are finished, the wafer is separated into individual chips (dicing). These chips are connected to a metal frame called a lead frame using metal wire (wire bonding) and then enclosed in ceramic or epoxy resin material (packaging).

ウェーハ工程が終わったウェーハを一つ一つのチップに切り分け（ダイシング）、リードフレームと呼ばれる金属の枠に金線で接続（ワイヤーボンディング）し、セラミック、樹脂などで封入（パッケージング）します。

▶ ZI-3600/ZI-2000  
Wafer Pattern Inspection System

▶ VM-3500/VM-2500  
Spectroscopic Film Thickness Measurement System

ZI-3600

▶

Activation  
活性化

Activation is performed by heating the substrate instantaneously using a laser or flash lamps. These tools are able to activate the doped ions without diffusion. Instantaneous activation, measured in microseconds, is required to create the micro transistors on the substrate.

注入した不純物イオンを活性化させるため、フラッシュランプやレーザー照射による熱処理を行います。極小のトランジスタを作るには一瞬でウェーハを昇温し、活性化させる必要があります。

▶ LA-3100 Flash Lamp Annealer

LA-3100

▶

Resist Stripping  
Post-Ash Cleaning  
レジスト剥離・剥離後洗浄

Resist can be stripped off in one of two ways: using chemicals to remove the resist; or by ashing, which removes the resist by inducing a chemical reaction using gases. If ashing is used to remove the resist, the wafer is cleaned afterwards.

薬液で剥離する方法、ガスと化学反応させることでレジストをアッシング（灰化）する方法があります。アッシング後にも洗浄が行われます。

▶ SU-3400/SU-3200/SU-2000  
Single Wafer Cleaner

▶ FC-3100/WS-820L/CW-2000 Wet Station

SU-3400

▶

Implantation of Impurities  
不純物注入

In order to give the silicon substrate semiconducting properties, impurities such as phosphor or boron ions are implanted in the wafers.

シリコン基板に半導体の特性を持たせるため、リンやボロンなどの不純物イオンをウェーハに注入します。

▶ FC-3100/WS-820L/CW-2000 Wet Station

▶ SP-2100 Spin Processor

▶ SU-3400/SU-3200/SU-2000  
Single Wafer Cleaner

SU-3400

▶

Etching  
エッチング

There are two kinds of etching. In wet etching, the thin film is dissolved using a chemical solution such as hydrofluoric acid or phosphoric acid. In dry etching, it is removed using reactive ions or gas.

フッ酸、リン酸などの薬液により、露出した薄膜を腐食し、除去します。これによりパターンを形成します。また、イオンをぶつけて薄膜を削り取るドライエッチングもあります。

▶ FC-3100/WS-820L/CW-2000 Wet Station

▶ SP-2100 Spin Processor

▶ SU-3400/SU-3200/SU-2000  
Single Wafer Cleaner

SU-3400

These processes are repeated  
これらの工程を繰り返す



## Process Technology Center

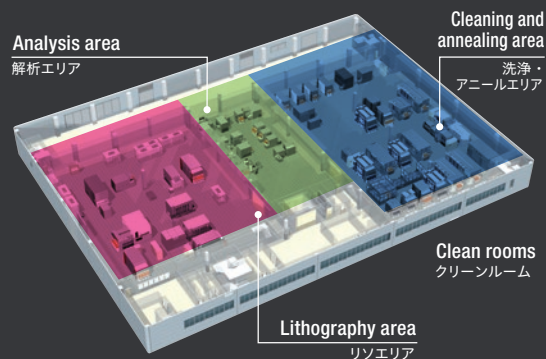
### プロセステクノロジーセンター

The Process Technology Center is equipped with a clean room dedicated to the evolution of efficiency and advancement processes of semiconductor manufacturing equipment. Here, we conduct a broad range of research and innovation to meet our client's needs such as:

1. Enhancement of process development capabilities
2. Improvement of equipment quality and reliability
3. Accelerate the joint development with our customers

半導体製造装置における最先端のプロセス開発の効率化・迅速化を実現するため、開発専用のクリーンルームと各種実験装置を完備した「プロセステクノロジーセンター」を設置。お客さまの課題を解決するソリューションを提供するため、多岐にわたる研究開発を行っています。

1. プロセス開発能力の強化
2. 装置品質、信頼性の向上
3. お客さまとの共同開発のスピードアップ



## Global Training Center

### グローバルトレーニングセンター「匠-TAKUMI-」

The Takumi Global Training Center is a space dedicated to training engineers. The center provides customer training for product maintenance, installation and setups, as well as develop field service engineers responsible for a broad range of support services. The engineers gain:

1. Product knowledge and work skills necessary for product support
2. Education essential to semiconductor production line operations
3. Safety training based on SCREEN's work safety standards

半導体製造装置メーカーに求められる技術者育成機能を結集した、グローバルトレーニングセンター「匠-TAKUMI-」。お客さまへの製品メンテナンス研修の提供、当社製品の搬入・セットアップ、各種サポートを担うフィールドサービスエンジニアの育成を行っています。

1. 製品サポートに必要な製品知識と作業技能の習得
2. 半導体製造ラインの作業に不可欠な知識の習得
3. SCREENの作業安全基準に基づいた安全訓練







# Corporate Philosophy

## 企業理念

### Mission 使命

Shape the Bright Future for Society and Employees

as a Result of Our Contribution to the Customers

顧客へ貢献することにより、社会と従業員にとって輝かしい未来を形作ります

### Vision ビジョン

To be a Company Recognized for Operational Excellence

事業運営において常に目標とされるエクセレントカンパニーになります

## 6 Core Values 6つの行動指針

- ▶ **Customer-Oriented**  
究極の顧客志向でお客さまの事業に貢献し、お客さまから愛される企業になろう
- ▶ **Commitment & Accountability**  
結果をコミットし、その結果に責任を持とう
- ▶ **Ownership**  
当事者意識を持って行動しよう
- ▶ **Quality**  
開発・製造・販売・サービスの質を向上させよう
- ▶ **Innovation**  
イノベーションでお客さまに貢献するとともに、私たちの仕事も常に変革しよう
- ▶ **Great place to work**  
仕事を通じて成長し、働きがいのある企業にしよう

# Company Profile

## 会社概要

### Company Name 社名

SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd.  
株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ

### Registered head office 本社所在地

Tenjinkita-machi 1-1, Teranouchi-agaru 4-chome, Horikawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8585  
〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町1番地の1

### Established 設立年月日

July 3, 2006  
2006年7月3日

### Representative 代表者

Masato Goto, Representative Director, President  
代表取締役 社長執行役員 後藤 正人

### Net Sales 売上高

370.9 billion yen (Fiscal year ended March 31, 2023)  
3,709億円（2023年3月31日現在）

Latest financial information here  
最新の決算情報はこちら



English



日本語

### Capitalization 資本金

310 million Yen  
3.1億円

### Number of consolidated employees 従業員数

3,480 (As of April 1, 2023)  
3,480人（2023年4月1日現在）



# Efforts to Achieve a Sustainable Society

サステナブルな社会の実現を目指す取り組み

## Participation in the Semiconductor Climate Consortium

半導体気候関連コンソーシアムへ参画

As one of the founding members, SCREEN participated in the Semiconductor Climate Consortium established by SEMI. We will continue to propose effective semiconductor ecosystem initiatives to address climate change issues.

SEMIにより設置された「半導体気候関連コンソーシアム」へ、創設メンバーの一員として参画。気候変動課題への効果的な半導体エコシステムの取り組みを提言していきます。

Read more >

English

日本語



For a video message regarding SCREEN's participation in the SCC, please click on the button below.

SCCへの参画について、SCREENからの動画メッセージを配信中です。ぜひご覧ください。

English

日本語



## Introducing "zeroboard," a cloud service for calculating and visualizing CO<sub>2</sub> emissions

CO<sub>2</sub>排出量算定・可視化クラウドサービス「zeroboard」導入

As an industry first, SCREEN has incorporated "zeroboard" into the semiconductor manufacturing equipment world. We will continue to monitor CO<sub>2</sub> emissions for SCREEN products and services.

半導体製造装置業界として初めて、「zeroboard（ゼロボード）」を導入。SCREENの製品およびサービス別におけるCO<sub>2</sub>排出量の可視化を進めていきます。

Read more >

English

日本語

### 「zeroboard」について

"zeroboard" is a cloud service developed by Zeroboard Inc., marketed by Nagase & Co., Ltd. It is used to calculate and visualize greenhouse gas (GHG) emissions derived from corporate activities and their supply chains based on the international standard GHG protocol.

長瀬産業株式会社が扱う、企業活動やそのサプライチェーン由来のGHG(温室効果ガス)排出量を、国際基準であるGHGプロトコルに基づき、算定・可視化できるクラウドサービス。

日本語

(Japanese only)



## Participation in imec SSTS

imec・SSTSへ参画

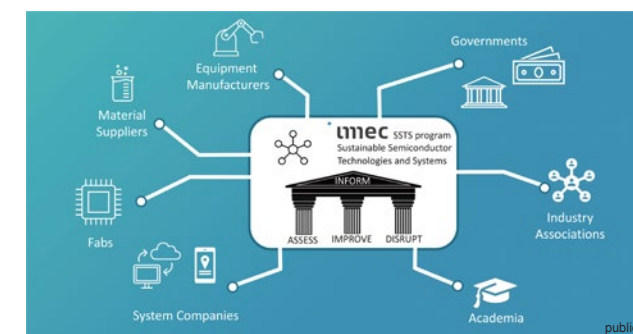
To reduce the environmental impact of the semiconductor industry, SCREEN participated in the new research program "SSTS" promoted by imec.

imecが進める半導体業界全体の環境負荷低減に関する新たな研究プログラム「SSTS」に参画しました。

Read more >

English

日本語



## Introducing a visualization application into the Hikone Plant's Process Technology Center

彦根・プロセステクノロジーセンターに「水管理アプリケーション」を導入

SCREEN has introduced FTD solutions INC's Water Management Application (WMA) to visualize water management to accelerate sustainability development. As the company with the top global market share for semiconductor cleaning systems, which consume water, we will accelerate advanced initiatives to reduce the environmental impact.

サステナビリティ開発を加速するため、水管理の可視化を実現するFTD solutions社の水管理アプリケーション(WMA)を導入。水を扱う半導体洗浄装置グローバルシェアNo.1企業として、環境負荷低減に関する先進的な取り組みを加速していきます。

Read more >

English

日本語

# SCREEN SPE GROUP COMPANY

SCREEN SPE Korea Co., Ltd.

Laser Systems & Solutions  
of Europe SASU (LASSE)

SCREEN SPE Germany GmbH

SCREEN Electronics Shanghai Co., Ltd.

SCREEN SPE Taiwan Co., Ltd.

SCREEN SPE Singapore PTE. Ltd.

SCREEN SPE USA, LLC

Head office

SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd.

SCREEN SPE Tech Co.,Ltd.

SCREEN SPE Service Co.,Ltd.

SCREEN SPE Works Co.,Ltd.

SCREEN SPE Quartz Co.,Ltd.

## SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd.

### Head office

- Tenjinikita-machi 1-1, Teranouchi-agaru 4-chome, Horikawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8585, Japan  
Phone: +81-75-414-7111  
京都(本社) / 602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町1番地の1 075-414-7111 (代)

### Global Network

International

Japan



Additional product and corporate information  
can be accessed from here.

screen spe 



English



日本語

[www.screen.co.jp/spe](http://www.screen.co.jp/spe)

本カタログの仕様ならびに機械デザインは改良のため変更されることがあります。  
Specifications and equipment designs are subject to change without notice.

No.154-165 V4 Printed in Japan 12-23 040CCI